



## フラッシュランプアニーリング装置

ウルトラショートタイムアニーリング装置

05

DTF-FLA ウルトラショートタイムアニーリング用にデザインされたスタンドアロン装置です。半導体材料、その他の材料に対して、数ミリ秒から数百ミリ秒の超短時間のアニーリングをすることが可能です。

仕様:

・基板サイズ: 最大. 50 mm x 50 mm , 100mmx100mm, 150mmx150mm対応  
---対応基板は装置モデルに依存します。

・パルス幅:

1.3 ミリ秒 - 12 J/cm<sup>2</sup> 最大

680 マイクロ秒 - 9 J/cm<sup>2</sup> 最大

300 マイクロ秒 - 5 J/cm<sup>2</sup> 最大

\* ご希望によりその他のパルス幅可能 (例. 200 マイクロ秒, 3 ミリ秒, その他)

・エネルギー密度: コンピューターで制御

・その他: 様々なガス雰囲気に対応する チャンバー(真空チャンバー等)  
予備加熱機構、水冷機構付き基板ホルダー等